



**講義** 2016年3月1日(火)13:15~16:00

**実習** 3月2日・3月3日 10:00~17:00

**会場** 北九州学術研究都市  
産学連携センター研修室 + 共同研究開発センター

定員50名  
(先着順)  
受講無料

主催：微細加工プラットフォーム（東京工業大学 および 北九州産業学術推進機構）  
協賛：ひびきの半導体アカデミー

本スクールは、文部科学省ナノテクノロジー・プラットフォーム事業の一環として、産学官の研究者に電子線描画リソグラフィ技術を中心とした超微細加工に関する装置やその原理を学習する場と、電子線描画リソグラフィ技術を実地に習得する機会を提供し、ナノテクノロジーにおける人材育成に貢献することを目的としています。

講義では電子線描画リソグラフィ技術およびフォトリソグラフィに関する講義3コマを行います。また希望者に対して、電子線描画リソグラフィに関する実習を実施します。

▼ 講義 (3/1) 13:15~16:00

13:15-13:25	ご挨拶 北九州産業学術推進機構 上野孝裕
13:25-14:20	「高精度電子ビームナノリソグラフィとその応用」 東京大学 生津英夫氏
14:30-15:15	「電子線リソグラフィの高解像・高速化」 日立中央研究所 山本治朗氏
15:15-16:00	「デバイス・プロセスを見込んだ電子ビーム露光」 東京工業大学 宮本恭幸氏

\*実習に参加される方は、16:20-16:45に実習実施に関する案内がありますので、忘れずに必ず参加して下さい。

▼ 実習 (3/2)・(3/3) 10:00~17:00 講師：東京工業大学 河田眞太郎氏

3/2	【実習】電子線描画基本コース	高速トランジスタでのTゲート作成に用いられる、三層レジスト形成というリソグラフィ工程の実習を行います。	定員3名	経験不問
3/3	【実習】電子線描画応用コース 事前に希望があった場合に設定します。 事前にプロセス内容に関する打合せが必要となります。	参加者が希望する加工パターンに即した実習も、個別に対応可能です。ただし、この場合は、東京工業大学ナノテクノロジーネットワーク支援プログラムに申請していただくことが前提となります。	定員3名	経験者

\*実習は関連する講義を受けることが必須です。 \*講義のみの参加も可能です。

応募資格

- 学部卒業以上 またはそれと同等以上の経験を有する産官学の研究・開発従事者 (大学院生は指導教員の許可を得ることが条件です)
- 電子線描画・微細加工に関する経験不問

◆実習期間中は、各実習開催機関の安全ガイドラインと専任スタッフの指示に従って作業をしていただきます。

お申込み

半導体・エレクトロニクス技術センターHPよりお申込みフォームに必要事項をご入力ください。

<応募締切>

講義：2016年2月23日(火)  
実習：2016年2月 2日(火)

実習ご希望の方は調整のうえ、追ってご連絡いたします。個別対応をご希望の方は備考欄にその旨をご記入ください。

お問合せ

公益財団法人北九州産業学術推進機構  
半導体・エレクトロニクス技術センター  
〒808-0138 福岡県北九州市若松区ひびきの北1番103  
TEL：093-695-3007 FAX：093-695-3667 担当：上野

半導体・エレクトロニクス技術センターHP

FAIS 半導体

検索

<http://www.ksrp.or.jp/fais/sec/>